

Reference (2)

(11)Publication number:

60-118236

(43) Date of publication of application: 25.06.1985

(51)Int.CI.

B01J 21/06 B01J 23/40 B01J 37/02 C₀₂F 1/72

(21)Application number: 58-224414

(71)Applicant: GIKEN KOGYO KK

(22)Date of filing:

30.11.1983

(72)Inventor: YOKOTAKE TARO

MIZUNO MITSUO

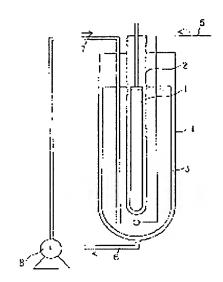
KOBAYASHI YASUHIRO

(54) MOLDED PHOTO-OXIDATION CATALYST BODY

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to obtain high purity water with good efficiency, by irradiating water containing an oxidizable substance with ultraviolet rays by using a photo-oxidation catalyst prepared by forming titanium oxide to the surface of a molded body comprising an inorg, material and supporting a platinum group metal by said supported molded body.

CONSTITUTION: Water containing a minute amount of an oxidizable substance is introduced into a reaction tank 4 from an introducing port 7 and air is introduced into said tank by an air diffusing pipe 5 while ultraviolet rays or light containing ultraviolet rays are allowed to irradiate said water from a light source 1 to oxidize the minute amount of the oxidizable substace in the presence of a porous cylindrical photo-oxidation catalyst 3 to take out high purity water from a discharge port 6. In this case, the photo-oxidation catalyst 3 is prepared by a method wherein organotitanate such as alkyl titanate is adhered to the surface of a molded body comprising an inorg. substance such as glass while the treated molded body is subjected to baking treatment at 350W700° C in an oxidative gaseous atmosphere to form titanium



oxide to the surface of the molded body or a platinum group metal such as platinum is further supported by the above mentioned titanium oxide. By using this photo-oxidation catalyst, high purity water can be prepared with good efficiency.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-118236

@Int_Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号	❸公開	昭和60年(198	35)6月25日
B 01 J 21/06 23/40		7202—4G 7624—4G			
C 02 F 1/72		7624—4G 6923—4D	審査請求 有	発明の数 1	(全5頁)

東京都渋谷区桜丘町13-10

公発明の名称 光酸化触媒成形体

②特 願 昭58-224414

❷出 顋 昭58(1983)11月30日

砂発 明 者 横 竹 太 郎 小金井市前原町3-10-14
 砂発 明 者 水 野 光 男 横浜市緑区寺山町183-8 ドルミ中山E-302
 砂発 明 者 小 林 康 裕 八王子市川口町1540

⑪出 願 人 技研與業株式会社

砂代 理 人 弁理士 秦野 拓也

明 桕 1

1. 発明の名称

光酸化触媒成形体

- 2. 特許請求の範囲
 - 7. 数量の被酸化性物質を含む水化紫外線もしく は紫外線を含む光を照射し水を純化する方法に 用いる光酸化触媒において、

無機材料よりなる成形体製面に有機チタネートを付着せしめたのち燃成処理して、当該成形体製面に酸化チタンを形成させ、もしくは更に上記酸化チタンに白金族金属を提持させることを特徴とする光酸化触媒成形体。

- 2. 前記有機チタネートはアルキルチタネート, アリルチタネート, チタンアシレート, チタン キレートの中から選ばれたいずれかの1種もし くは2種以上の混合物である、特許請求の範囲 第1項配収の光酸化触媒成形体。
- 3. 前記焼成処理が酸化性ガス芽囲気下で焼成温 度 350 C~ 700 Cの範囲で行なわれる、特許謝 求の範囲第1項記載の光酸化触媒成形体。

- 4. 前配白金族金属は白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウムの中から選ばれたいずれかの1 植もしくは2種以上の混合物である、特許請求 の範囲第1項配敷の光酸化触媒成形体。
- s. 的配無機材料よりなる成形体はガラス, アルミナ, シリカ, 酸化チタン, ムライト, コージライトの中から週ばれたいずれかを主体とし、 とれらを単独もしくは混合物とし、少量の結合 材を加えて成形, 焼結した成形体である、特許 請求の範囲第1項記載の光霞化触版成形体。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、酸量の被酸化性物質を含む水に、紫外線もしくは紫外線を含む光を、溶存酸紫の存在下で照射し、高純度の水を取得する方法に用いる光敏化触媒成形体に関する。

と」に本発明による被敵化性物質とは水に溶解している数量有機成分であつて、通常 CODcr (化学的破累要求量)値で表示される物質を主体とする

近年、諸豫要において技術が高度化するに伴つ

特開昭G0-118236(2)

一方、汚染排水の処理技術として酸化チョン等からなる酸粉末を懸濁した状態で使用する光酸化 触媒法が提案されている。この光酸化触媒法は汚染物を含む被処理水を酸化チョン等からなる光酸 化触媒に紫外線を含む光を照射しながら接触通水することによつて処理するものである。

か」る光酸化触媒は紫外線照射によりエネルや

ーを受けると表面において価電子帯の電子が伝導 帝に移行し、その結果、価電子帯に正孔を生する。 これら電子および正孔が符存酸素やヒドロキシル 益と反応して敬化力の強いスパーオキシド(O₂[▽]) ヤヒドロキシラジカルを生成させる、すなわち光 **鮻化放媒法はこのようにして生成したスパーオキ** シドヤヒドロキシラジカルが有機物を酸化して炭 酸ガスや水を生成する反応を利用するものである。 それ故、光酸化触媒法は有機物を限化分解するた めの酸化剤を加える必要がなく、有機物を無害な 炭酸ガスと水に分解でき、また光酸化触媒が不溶 性の白金族金属と酸化チタンとから構成されてい るため、従来法のように処理プロセス自体を構成 する物質が溶け出したり、分解生成物を放出する ことがないことから、貧量の有機物を除去する水 の純化処理技術としては極めて有利な方法である。

しかしながら、従来提案されている光像化 触供 法は有機物の酸化効率に重点がおかれ、光酸化触 供となる酸化チタンを酸粉末で使用している。そ のため被処理水を処理した後の水と光酸化触供と

を分離する点に技術的な離点が生ずる。光酸化触 供は白金族金属を含むので高価であり、水の純化 を経済的に行なりためには完全な分離,回収が必 要となる。しかしながら光酸化触媒が微粉末であ るため、完全な分離,回収を実施するといたすら に処理プロセスが複雑になり経済上また処理操作 上極めて不利になる欠点を有している。

本発明は上記に鑑みてなされたものであり、数量の被酸化性物質を含む水を、十分な溶存限素の存在下、紫外線を照射し光酸化触媒と接触させ納化するとき、無機材料よりなる成形体上に酸化ナタンあるいは酸化チタンに白金族金属を担持させた光酸化触媒を使用し、分離、回収を必要としない光酸化触媒成形体を提供するものである。

以下本発明による水の純化に使用する光酸化粧 媒について説明する。光酸化肽媒となる酸化ナタンは低温においては粒子間の焼結がおとりにくい ため、十分な機械的強度を有する成形体を得ると とが困難であり、逆に高温で焼結すると機械的強 跟は得られるが有効な光酸化肽媒としての活性が 得られない。本発明者等は酸化チタン光像化触媒 の欠点を克服すべく鋭意研究を行たつた趙果、酸 化チタンを後述の無機材料からなる成形体設面に 後述の方法で強固に付着させ、高い光触媒活性を 有する成形体が得られるととを見出し、この光像 化触媒成形体は高純度の水を能率よく製造するの に最適であることを確めた。光酸化触媒成形体を 得るために使用する無機材料はガラス,アルミナ シリカ、酸化チョン、ムライト、コージライト等 の中から選ばれたいずれかを主体とし、これらを 単独もしくは混合物として使用し、少量の結合材 を加えて成形、焼結して成形体とする。成形体は 平板状、円筒状、円柱状等任意の形状を選びかつ 多孔質とするかもしくは我面に凹凸を設け、光照 射部製面板の大きいもので、用いる装置に適合し、 光照射面板が効率的に利用できるような形のもの とすることが好ましい。なお無機材料としては上 記のほか、長石、粘土質等よりなる陶器、 世解用 **素焼隔膜、屋根ガワラ等の土器、レンガ、タイル** 等の炻 器頭も有根チタネートが付着すれば使用可

特開昭60-118236(3)

能である。光酸化触媒は上記の無機材料成形体要面に有機チタネートを付着させ、一定の糖成条件で処理し、酸化チタンとし、必要な場合は更に自金族金銭を拒持させることによつて得られる。

次にその製法を詳述する。

有様チタネートを付着させた無機材料成形体は・・ 100 じ~110 じで乾燥後、酸化性ガス雰囲気下で 焼成温度 350~ 700 Cの範囲, 好きしくは 400~ 500 ℃の範囲で柴成処理する。その結果有機チャ ネートが酸化分解されて、高い光酸化触媒活性を 有する酸化チョンで覆われた成形体が得られる。 焼成温度としては 350 でより光酸化触媒活性を有 する酸化チョンが得られはじめ、700℃以上の高 温では光酸化触媒活性が失われる。なお、無機材 科表面への有機チタネートの被覆量が多いと、乾 躁あるいは焼成過程でひび割れを生じて成形体表 面から剝離する恐れがあるので、これを防ぐため **に1回当りの有機チタネートの被観量を少くして、** すなわち、有根チタネートの被覆一乾燥一焼成如 理を必要な回数だけ繰り返すととによつて、希望 する酸化チタンの膜厚に調製する。

こ」に得られた酸化テタンを付着した成形体で も水の純化用光酸化触媒成形体として十分使用で きるが、この酸化チタン表面に白金族金額を担持 することにより、更に効率の良い光酸化触媒成形

体が得られる。担持する金属として白金、パラシウム、ロジウム、ルテニウム等の中から通ばれたいずれかの1 種もしくは 2 種以上の温合物が使用できる。これらの金属を使化チタンを付着した成形体に担持させる方法としては、これらの金属を水路性無機化合物の形で含有する水溶液の中に、成形体を浸漬した状態で紫外級を照射することによつて金属を担持させる方法、あるいは選元別を加えて金属を担持させる方法等によつて行なり。

金属担持の主なる目的は、紫外線の照射により 酸化チタンの表面に生成した粒子と正孔の再結合 を防ぐことにある。光照射面積に対する金偶の被 優率を小さく、そして単位光照射面積における金 関のスポット数が大きいほど光酸化触媒活性が高 くなる。それ故、金属の付着量、および付着状態 をコントロールしつよ金属を担持させる。金属の 能は酸化チタンに対し0.01 wt 5~1 wt 5 である。 図は本発明の光酸化触媒を水の純化に使用する 場合の基本的概念を説明する図である。

反応槽 4 の中央部に 酸化チタンあるいは白金担

持酸化チタンで被優した多孔性の円筒状光酸化触 媒成形体 3 があり、その内側に光源 1 を内蔵した 石英質 2 がある。光源は波長がおよそ 420 nm 以 下の光を発する例をは高圧水銀灯、低圧水銀灯、 プラックランプ、キセノンランプ等であり、太陽 光も光源として使用可能である。光源は保護のため石英質 2 に挿入されているが、高圧水銀灯を使 用する場合はパイレックスガラス等も使用できる。

被処理水はポンプ8により導入口7より反応槽4に入り、散気管5により空気または酸素が導入され、光源1によつて照射され、光敏化触媒3により酸量の被酸化物質が酸化され、高純度水として排水口6より取り出せる。必要に応じ処理水をポンプ8により循環しつつ照射を行なりこともできる。

この光酸化触媒成形体を使用すれば、酸化チタンは粉末でないため、分離したり回収したりする必要はなく、成形体に固く付着しているため長時間使用しても脱落することがなく、高活性の飲化能力を維持できるのみならず、不純物が部け込む

特問昭60-118236(4)

おそれもないので極めて高純度の水が得られ、又 とのとき紫外線を含む光源を用いると、カピ、パ クテリヤ、クイルス等の教育処理も同時に行なえ るので、その効果は極めて大きい。

以下に実施例を示す。

吳施例1

洗浄を行なつたのちデキストラン水溶液 500 配 (CODcr 6.8 m/4)とともに反応槽に入れ、空気 を吹き込みながら、光源として 6 W の架外線数菌 灯を使用し 20 時間照射したところ CODcr 機度は 0 m/4となつた。

突的例 2

ンりカ酸維を素材とした内径 6.0 cm、長さ 20.0 cm の透水性円筒型成形体をジーインプロポキンパス(アセチルアセトナタ)チタン 10 部, イソプロピルアルコール 90 部, メタノール 400 部からなる協合溶液に浸漬し、ついて取出し 110 でで乾燥を、空気雰囲気下で 500 でで 3 時間焼成を行なってシリカ 最面に酸化チタンを被獲させる。 との処理(浸漬一乾燥一焼放)を3回くり返したのも超音波洗浄を行い、その後酢酸, 炭酸ナトリウムンよび塩化白金酸を加えた混合液に浸漬しながら成形体の内側に低圧水銀灯を挿入して光照射を行ない、内側の酸に白金を担持させた。

得られた白金担持酸化テタン被硬成形体を、超 音波洗浄を行なつたのち、デキストラン群液

(CODcr 譲度 6.8 mg/L) 700 ml を流量 100 ml/min で 8.0 時間空気を吹き込みながらポンプで循環し 6 W の紫外線殺菌灯によつて照射したところ、 CODcr 張度は 0 mg/L となつた。

夹施例3

1/1となつた。

突施例 4

表面にガラスなコーティング したアルミナ粒子 からなる内径 4.3 cm, 長さ 20.0 cm の多孔性円衡型 成形体(商品名 ケラミフイルター)の内側に刷子 を用いてイソプロピルチタネート 30 部。 イソプ ロピルアルコール 130 部 および 酢酸 10 部 からな る混合溶液を塗布したのち110℃で乾燥後、空気 労 照 気 下 500 じ で 3 時 間 焼 成 を 行 な つ て 表 面 に 酸 化チョンを被覆させた。この処理(浸渍一乾燥ー 焼成)を3回くり返したのち粗音放洗浄を行い、 その後、酢酸、炭酸ナトリウムおよび塩化白金酸 塩を加えた混合液に受演しながら成形体の内側に 低圧水銀灯を挿入して光照射を行ない、内側の壁 に白金を担持させた。得られた白金担持酸化チタ ン被模成形体を、再び超音波洗浄を行なつたのち デキストラン溶液 (CODcr 後度 6.8 mg/4) 700 ml を祝量 100 W/min で 2.0 時間、空気を吹き込みを がらポンプで循環し、100 Wの高圧水銀灯によつ て照射したととろ CODcr 設度は 0m/1となつた。

領南昭 GO-118236(5)

突炸例 5

コージェライト(2 Mg O・2 AL2 O3・5 Si O2)からなる直径 4.0 cm, 厚さ 5 mm, 長さ 20.0 cm の円筒形成形体をヒドロキシチタンステアレート 30 mm, フェニルチタネート 20 mm, トルエン 130 部 からなる配合溶液に浸渍し、乾燥処理後 500 でで 1 時間焼成を行なうことによつて酸化ナタンを被覆した成形体を得た。この成形体を、超音波洗浄を行なつたのち光酸化触磔としてデキストラン溶液500 ml (CODcr 4.0 ml/L)とともに反応間に入れ、空気を吹き込みながら 6 Wの低圧水銀灯を 2.0 時間照射した。その結果、CODcr 微度は 0 ml/L となつた。

4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の光酸化触媒による高純度水製造の基本概念説明図である。

1 …光源、 2 …石英管、 3 … 光度化 触媒、
 4 …反応槽、 5 … 飲気管、 6 … 排水口、
 7 … 導入口、 8 … ポンプ。

特許出願人 技研異類株式会社 代理 人 弁理士 築 野 拓 也

